

真空チャンバー付プローブ装置 VP - 6903

半導体デバイスの評価・解析を高温下で行う為のプローブ装置で、真空状態又はアルゴンガス等を供給し無酸素雰囲気中でデバイスの酸化を防止しながらの測定が可能です。

特徴

真空チャンバー内試料台のX-Y軸移動、ローテーション及びプローブカードキャリアのZ軸上下動の外部操作が可能です。
試料台の温度は最高 400 まで昇温可能です。
試料台のリーク電流は 300 時で 1pA/0 ~ 20V 以下です。
チャンバーは、冷却水循環装置で冷却しています。



チャンバー内部



仕様

真空チャンバー部

- チャンバー 材質:SUS304(内面電解処理) 真空度:1.33Pa(10^{-2} Torr) ポート数:14 ウィンドウサイズ: 100mm 真空計付き
- プローバー チャックトップサイズ: 120mm
- 試料台移動量 X: ± 40 mm, Y: ± 40 mm, 可変量: $\pm 10^\circ$
- プローブカードアダプタ Z 軸移動量: 10mm チルト機構付き(試料交換時)
- 真空ポンプ E2M30AAC100V, 10A EDWARD 製(又は、相当品)
- 顕微鏡 SZ61/SZX7 実体顕微鏡(オリンパス製)
- インターロック機構 上蓋開閉ロック機構及び顕微鏡破損防止インターロック

温度制御部

- 温度コントローラ AT-3000H
温度設定範囲: 50 ~ 500 温度表示: 4桁(0.1) 温度センサー: Kタイプ x 2 外部インターフェース: GP-IB
- 過昇温防止回路 ハードウェア及びソフトウェア: 450
- 保安回路 主電源: 漏電・過電流遮断機及び非常停止スイッチ
- その他安全装置 冷却水循環モニター

冷却水循環装置

- 冷却水温・制御範囲 10 ~ 25 冷却能力: 2100Kcal 水槽容量: 43 循環ポンプ: モーター250W

アクセサリ

- 高温プローブカード 温度保障範囲: ~ 400 材質: セラミック

ユーティリティ

- 電源 AC100V 50/60Hz 20A
- その他 N_2 を使用する場合: 0.5 ~ 3.0kg/cm²(49 ~ 294kpa)

設置面積

- 1000mm(W) x 1000mm(D)

OMNIPHYSICS

オムニフィジックス株式会社
〒213-0001

神奈川県川崎市高津区溝口 6-23-14
TEL. 044-455-7002 FAX 044-455-7003